

2009年1月13日

ワークショップ No.27 参加者各位

日本学術振興会
プロセスシステム工学第143委員会
委員長 長谷部 伸治
ワークショップ No.27 代表者
京都大学大学院工学研究科
准教授 加納 学

プロセスシステム工学第143委員会
ワークショップ No.27・第11回研究会開催通知
(<http://ws27.pse143.org/>)

1. 日時：2009年1月26日（月）13:00～17:00 研究会
2. 場所：東京農工大学 小金井キャンパス 講義棟（12号館）L0016 講義室
（東京都小金井市中町 2-24-16）（交通案内 <http://www.tuat.ac.jp/access/tra5.html>）

3. 内容：

講演：「半導体製造プロセスにおける制御と課題」

ソニー 平井 都志也 氏

概要：半導体プロセスにおいては数百工程（数百装置）をプロセスフローに基づき順次シリコンウエハの加工を行っているが、各工程毎に検査結果を加工装置にフィードバックする「Run to Run System」により出来栄を保障している。今回は半導体プロセスにおける一般的な制御方法とそこに潜む課題について紹介する。

報告1：VAプロセスの基本制御系構成の提示

プラントワイド制御 Gr

報告2：VAプロセスへの Self-Optimizing Control 適用結果中間報告

プラントワイド制御 Gr（京都大学 中村 尚登 氏）

報告3：MPCモデルミスマッチ検出ケーススタディ結果報告

MPC保守 Gr（京都大学 信貴 洋平 氏）

報告4：PID制御&閉ループ同定の検討方針について

PID制御&閉ループ同定 Gr

討議：今後の検討内容について

[その他]

- ・ 準備の都合がありますので、1月21日（水）までにご出欠についてご連絡下さい。

[出欠連絡先]

京都大学大学院工学研究科化学工学専攻 加納 学

E-mail: manabu@cheme.kyoto-u.ac.jp